

© 1993

## ТУННЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ ФЕРРОМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

Д.И. Семенцов, В.В. Ефимов,  
С.А. Афанасьев

В [1, 2] установлена возможность наблюдения интерференции двух когерентных волн, падающих на металлическую пластинку с противоположных сторон, названной туннельной в силу наличия мнимой компоненты у волновых векторов волн, проникающих в пластинку. При этом вне пластинки имеет место интерференция односторонних волн — прошедшей и отраженной, тогда как внутри интерферируют встречные волны. Управление энергетическими параметрами интерференционного потока, проходящего через поглощающий слой, представляется перспективным с точки зрения практического использования данного явления. В настоящей работе показана возможность эффективного управления интерференционным потоком в намагниченной поглощающей пластинке с помощью внешнего магнитного поля, меняющегося вблизи значения поля ферромагнитного резонанса, соответствующего данной частоте, и приводящего к значительному изменению высокочастотной магнитной проницаемости образца.

На рис. 1 представлена схема падающих на пластинку и проходящих через нее волн, ориентация намагниченности  $\vec{M}$  и подмагничивающего поля  $\vec{H}_0$ . Падающая справа на поверхность пластинки  $y = d$  линейнополяризованная волна имеет компоненту электрического поля  $E_{za}^{\text{пад}} = A \exp[-i(\omega t - k_0 y)]$ , а падающая слева на поверхность  $y = 0$  волна имеет компоненту поля  $E_{zb}^{\text{пад}} = B \exp[-i(\omega t + k_0 y)]$ . Здесь  $k_0 = \omega/c$ , а комплексные амплитуды  $A = |A| \exp(i\varphi_a)$ ,  $B = |B| \exp(i\varphi_b)$ , где  $\varphi_a$  и  $\varphi_b$  — начальные фазы падающих волн на поверхностях пластинки. Решение граничной задачи для слоя со скалярными диэлектрической проницаемостью  $\epsilon$  и проводимостью  $\sigma$ , тензорной магнитной проницаемостью  $\hat{\mu}$ , находящегося в вакууме, приводит к следующему выражению для усредненного по периоду волнового потока в области  $y > d$ :

$$S = \frac{c}{8\pi} \operatorname{Re} \left[ \left( E_{za}^{\text{пад}} + E_{za}^{\text{отп}} + E_{zb}^{\text{пад}} \right) \left( H_{xa}^{*\text{пад}} + H_{xa}^{*\text{отп}} + H_{xb}^{*\text{пад}} \right) \right] = \\ = S_a^{\text{пад}} + S_a^{\text{отп}} + S_b^{\text{пад}} + S_{ab}^{\text{отп}}, \quad (1)$$

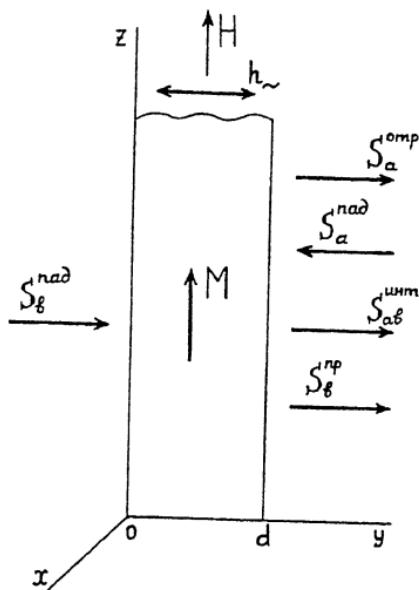


Рис. 1.

$$S_a^{refl} = \frac{c}{8\pi} |A|^2, \quad S_a^{trav} = \frac{c}{8\pi} R_a |A|^2, \quad S_b^{trav} = \frac{c}{8\pi} T_b |B|^2.$$

Интерференционный поток в указанной области определяется интерференционным взаимодействием двух однонаправленных волн – прошедшей и отраженной:

$$S_{ab}^{int} = \frac{c}{8\pi} Re \left( E_{za}^{trav} H_{xb}^{*trav} + E_{zb}^{trav} H_{xa}^{*trav} \right) = \frac{c}{8\pi} |A||B| J_{ab} \cos \Delta_{ab}. \quad (2)$$

Здесь  $J_{ab} = 2\sqrt{R_a T_b}$  – коэффициент интерференционной прозрачности,  $\Delta_{ab} = \varphi_a - \varphi_b - \alpha$ ,  $\alpha$  – суммарный набег фаз, получаемый  $b$ -волной при прохождении слоя и  $a$ -волной при отражении от слоя, энергетические коэффициенты отражения и прохождения  $R_a = |r_a|^2$  и  $T_b = |t_b|^2$ ; соответствующие амплитудные коэффициенты определяются выражениями

$$r_a = \frac{(\alpha^2 - 1) \sin kd \exp(2ik_0 d)}{(\alpha^2 + 1) \sin kd + 2id \cos kd}, \quad (3)$$

$$t_b = \frac{2\alpha i \exp(ik_0 d)}{(\alpha^2 + 1) \sin k_0 d + 2id \cos k_0 d},$$

$$\alpha = ik_0 (4\pi\delta - i\omega\varepsilon)^{-1}, \quad k^2 = \frac{k_0 \mu_\perp}{c} (4\pi\delta - i\omega\varepsilon).$$

Из (2) видно, что в отличие от потоков прошедшей  $S_a^{op}$  и отраженной  $S_a^{opt}$  волн, величина и направление интерференционного потока  $S_{ab}^{int}$  существенно зависит от результирующей фазы  $\Delta_{ab}$ . Суммарный проходящий поток  $S^\Sigma = S_a^{op} + S_b^{op} + S_{ab}^{int}$  при соответствующих значениях  $\Delta_{ab}$  достигает минимального и максимального значений:

$$S^\Sigma = \frac{c}{8\pi} (\sqrt{\rho_a} |A| \pm \sqrt{T_b} |B|)^2. \quad (4)$$

Из (4) следует, что  $S^\Sigma$  может намного превышать поток  $S_a^{op} + S_b^{op}$ , в чем и заключается практическая значимость рассматриваемого эффекта.

Выражение для  $\mu_\perp = \mu - \frac{\mu_d^2}{\mu}$ , где  $\mu$  и  $\mu_d$  - диагональная и недиагональная компоненты тензора  $\hat{\mu}$ , определяется на основе решения уравнения Ландау-Лифшица [3] и имеет вид

$$\mu_\perp = \frac{(\omega_H + \omega_M)^2 - (\omega - i\omega_x)^2}{\omega_H(\omega_H + \omega_M) - (\omega - i\omega_x)^2}, \quad (5)$$

где в отсутствие магнитной анизотропии и с учетом выбранной ориентации подмагничивающего поля относительно поверхности пленки

$$\omega_H = \gamma H, \quad \omega_M = 4\pi\gamma M, \quad \omega_x = \xi \omega_H.$$

Здесь гиromагнитное отношение  $\gamma = 1.76 \cdot 10^7$  (э.с.) $^{-1}$ ,  $\xi$  - параметр релаксации. Из (1-4) следует, что вблизи резонансного поля

$$H_p \approx \sqrt{4\pi^2 M_0^2 + (\omega/\gamma)^2} - 2\pi M_0 \quad (6)$$

должны иметь место особенности в полевой зависимости коэффициентов прохождения, отражения и интерференционной прозрачности

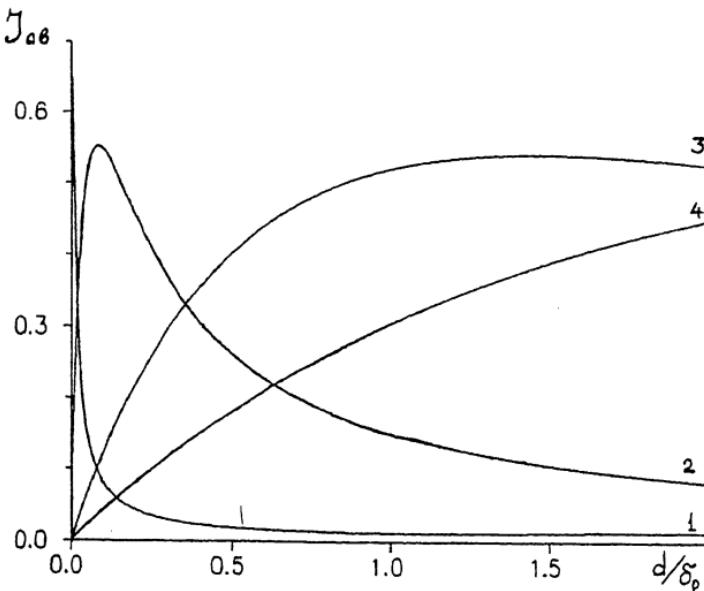


Рис. 2. Зависимость коэффициента  $J_{ab}$  от толщины слоя при различных значениях подмагничивающего поля.

сти. Для расчета выбраны параметры монокристаллической феррошпинели  $MnFe_2O_4$ :  $\mathcal{E} = 10$ ,  $\sigma = 1.4$  ( $\Omega \cdot m$ );  $4\pi M_0 = 4.4 \times 10^3$  Гс, резонансное поле  $H_p = 72$  э и ширина линии ФМР  $\Delta H = \xi H_p = 4$  э на рабочей частоте  $\omega = 10^{10}$  с<sup>-1</sup> [4, 5]. На рис. 2 представлены зависимости коэффициента интерференционной прозрачности  $J_{ab}$  от приведенной толщины  $d/d_p$ , полученные для резонансного и достаточно удаленного от резонансного полей (кривые 1–4 соответствуют  $H = 72, 90, 400$  и  $1300$  э). Видно, что характер указанной зависимости существенно зависит от значения подмагничивающего поля. При расчете резонансная глубина скин-слоя вычислялась по формуле  $\delta_p = c / \sqrt{2\pi\sigma\omega\mu''_r}$ , где минимальная часть магнитной проницаемости

$$\mu''_r = \frac{2\omega\omega_r\omega_m(\omega_h + \omega_m)}{[\omega_h(\omega_h + \omega_m) - \omega^2]^2 + 4\omega^2\omega_r^2} \quad (7)$$

определенна при  $H = H_p$ . Для выбранных параметров  $\delta_p \approx 1.5 \times 10^{-2}$  см. На рис. 3 представлены полевые зависимости коэффициента  $J_{ab}$ , полученные для различных толщин пластиинки  $d$ . При  $d \ll \delta_p$  вблизи поля  $H_p$  наблюдается резонансный характер зависимости  $J_{ab}(H)$ . С ростом толщины пластиинки в области резонансного поля обнаруживается минимум интерференционного коэффициента, а его максимум сдвигается в область больших полей.

Наряду с  $J_{ab}$ , суммарный набег фаз прошедшей и отраженной волн  $\alpha$  также является функцией подмагничивающего поля и вблизи резонанса меняется в достаточно широких пределах. Поэтому

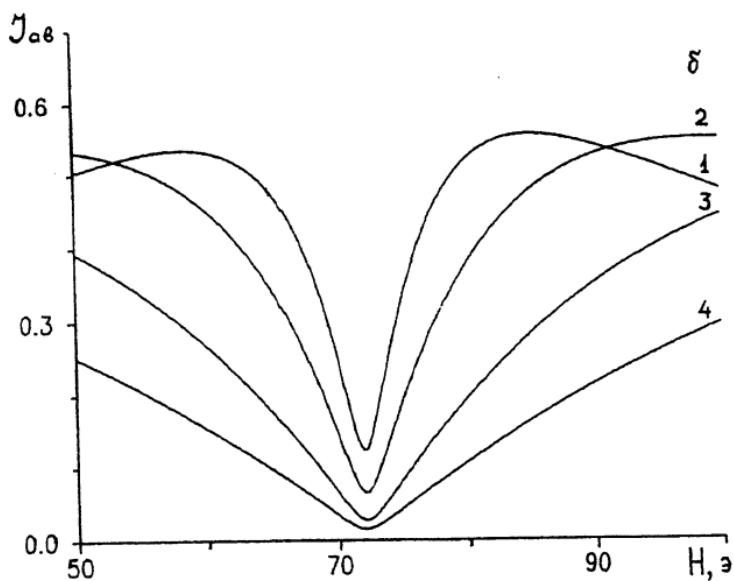
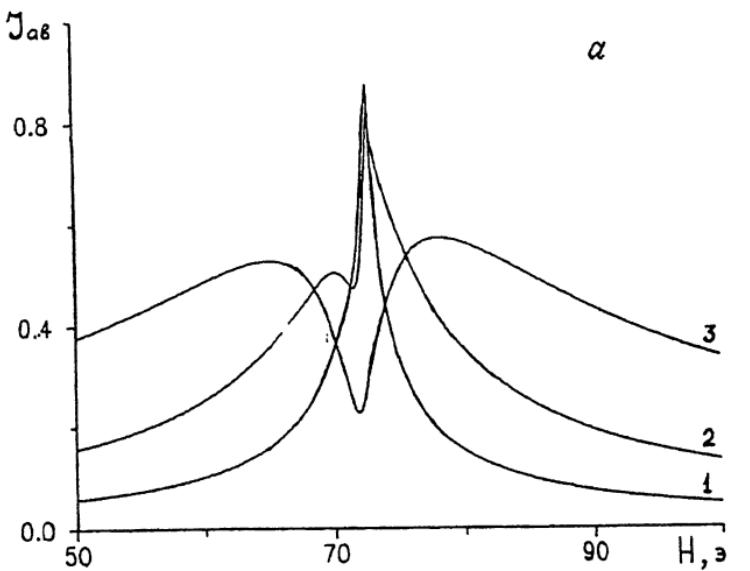


Рис. 3. Полевые зависимости коэффициента  $J_{ab}$ , кривые 1 – 3:  $d = 0.5, 1.5, 5$  мкм (а); кривые 1 – 4:  $d = 10, 20, 50, 100$  мкм (б).

суммарный поток  $S^{\Sigma}$ , в соответствии с (4), можно также менять подмагничивающим полем в достаточно широких пределах. Используя указанную зависимость, можно осуществить эффективную амплитудную модуляцию потока.

В заключение отметим, что выбор металлических пленок в качестве объекта наблюдения туннельной интерференции на СВЧ частотах [2], на наш взгляд, нецелесообразен, так как на этих частотах и коэффициенты  $T$  и  $J$  ничтожно малы. Расчеты пока-

зывают, что для пленки с проводимостью  $\sigma \approx 5 \cdot 10^{16} \text{ С}^{-1}$  даже при  $d = 50 \text{ \AA}$  коэффициенты  $T \approx 4 \cdot 10^{-5}$ , а  $J \approx 2 \cdot 10^{-3}$  (хотя в [2] приведено значение коэффициента прохождения  $T = 0.27$ ). В этой связи для наблюдения указанного явления должны выбираться материалы с  $4\pi\mu\gg\omega\epsilon$  (ферриты, полупроводники). Если же  $4\pi\mu\gg\omega\epsilon$ , то выполняется известное соотношение  $R=1-\sqrt{2}\mu\omega/\pi\mu$ , т. е. почти вся падающая на пленку энергия отражается, что и приводит к малому интерференционному эффекту.

### Список литературы

- [1] Сидоренков В.В., Толмачев В.В. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 21. С. 34-37.
- [2] Сидоренков В.В., Толмачев В.В. // Письма в ЛТФ. 1990. Т. 16. В. 3. С. 20-24.
- [3] Гуревич А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках. М.: Наука, 1973. С. 37-44.
- [4] Крупичка С. Физика ферритов. Т. 2. М.: Мир, 1976. С. 414-462.
- [5] Яковлев Ю.М., Гендель С.Ш. Монокристаллы ферритов в радиотехнике. М.: Сов. радио, 1975. С. 232.

Филиал московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,  
Ульяновск

Поступило в Редакцию  
24 октября 1992 г.  
В окончательной редакции  
6 мая 1993 г.